科学研究費助成事業

研究成果報告書



交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,600,000円

研究成果の概要(和文):ナノメートルサイズの金属微粒子に可視光を照射すると自由電子の集団振動が励起され、これに伴って微粒子近傍に巨大な光電場が発生する。この現象は局在プラズモン共鳴と呼ばれ、光が関係す る様々な技術の効率を向上させるのに役立つと考えられている。本研究では、金属とは異なり局在プラズモンの 周波数を赤外光領域でチューニングできるとされている半導体ナノ粒子に着目した。硫化銅ナノ粒子の基礎光学 特性を詳細に調べ、局在プラズモン共鳴の特徴を明らかにした。また、その共鳴周波数の制御法を開発した。

研究成果の概要(英文): Localized surface plasmon resonance (LSPR) is a collective oscillation of conduction electrons that have been directly excited by light, and it is a characteristic optical response of metal nanoparticles. LSPRs provide an electric field enhancement nearby the nanoparticle's surface. Such a strong near-field can dramatically improve the efficiency of light-matter interaction and enables various photonic applications. In this project, frequency-tunable LSPRs of doped semiconductor nanoparticles were studied. Fundamental optical properties of copper sulfide nanoparticles were investigated and characteristics of their LSPRs were elucidated. Furthermore, fabrication methods of frequency-tunable plasmonic copper sulfide nanoparticles were developed.

研究分野:光物性物理学

キーワード: 局在プラズモン共鳴 ナノ粒子 半導体 増強近接場 キャリア密度制御

1.研究開始当初の背景

金などの金属ナノ構造体の局在プラズ モン共鳴が、微細計測やフォトニクス材 料への応用の観点から注目を集めている。 その理由は局在プラズモンの励起にとも ない金属ナノ構造近傍に巨大な局所光電 場が発生することにある。これを利用し た単一分子の蛍光検出、単一ナノ粒子の マニピュレーション、発光素子、太陽電 池、非線形光学デバイス等の高効率化が 期待されている。このような技術はプラ ズモニクスと呼称され活発に研究がおこ なわれている。

一方、金属ではなく半導体においてもド ーピングにより伝導キャリア密度を 10²¹ cm⁻³ 台の縮退領域にまで高めることができ る。縮退半導体のナノ粒子では局在プラズ モン共鳴が近赤外領域(波長1~2 µm)に 現れることが実際に確認されている。金属 と異なり半導体の伝導キャリア密度はドー ピングにより増減させられるので、局在プ ラズモンの共鳴周波数を選択的に変化させ ることができる。

半導体ナノ粒子の光学応答は一般に励起 子によって特徴づけられるが、高キャリア 密度の半導体ナノ粒子の光学応答には未知 な点が多く興味深い。また、励起子と局在 プラズモンがクロスオーバーする領域では、 一つのナノ構造体中に励起子と局在プラズ モンが同時に励起される可能性が考えられ る。これは、これまで盛んに研究されてき た個別の金属ナノ粒子と半導体ナノ粒子を 合体させたハイブリッド構造では実現でき ない本質的に異なる状態である。高キャリ ア密度半導体ナノ粒子においては、単一の ナノ空間に閉じ込められた励起子と局在プ ラズモンの間に強い結合・共鳴・エネルギ ー交換が生じ、光と物質の相互作用が飛躍 的に向上すると考えられる。

代表者は1990年台から貴金属ナノ粒子の 非線形光学特性に関する研究に取り組んで きた。その結果、局在プラズモン共鳴とそ れに付随する局所電場増強効果に関して多 くの知見を得た。一方、連携研究者ととも に、約10年前から半導体ナノ粒子(CulnS₂、 Cu₂ZnSnS₄など銅硫化物系)の光物性の研究 を開始した。その過程で Cu₂S ナノ粒子が近 赤外領域にブロードな吸収帯を示すことを 見出した。その後、この吸収帯の起源とし て局在プラズモン共鳴が提唱されるように なった。上述のように、半導体ナノ粒子で はキャリア密度を制御して局在プラズモン 共鳴の共鳴周波数を変化させることができ るので、それによって励起子と局在プラズ モンの相互作用を制御できる可能性がある など、これまでに研究してきた金属ナノ粒 子の局在プラズモンよりもはるかに多様な 現象が発現し得ることに着目し、本研究を 着想するに至った。

- 2.研究の目的
- 半導体ナノ粒子の光学応答の主体が 低キャリア密度での励起子からキャリ ア密度が増加して局在プラズモンへ変 化するクロスオーバー領域での両者の 相関現象を解明することが本研究の最 終的な目的である。具体的には、半導体 ナノ粒子のキャリア密度を系統的に制 御して光学応答の変化を調べ、励起子と 局在プラズモンのクロスオーバー過程 に関する知見を得る。特にその境界領域 において両者の相互作用によって発現 する現象とそのメカニズムを明らかに する。そのために、以下の四項目の研究 を実施する。
 - (1) 高キャリア密度半導体ナノ粒子 の局在プラズモン共鳴の特徴を 明らかにする。
 - (2) 半導体ナノ粒子の光学応答を励 起子から局在プラズモン共鳴へ と精密に変化させる技術を構築 する。
 - (3) 励起子と局在プラズモン共鳴の クロスオーバーする領域におい て、両者の相互作用のメカニズム を明らかにする。
 - (4) 従来の金属ナノ材料ベースのプ ラズモニクスでは実現できない 高キャリア密度半導体ナノ粒子 の特性を生かした応用への展望 を示す。

3.研究の方法

(1)正孔密度を制御した硫化銅ナノ粒子 の作製と構造およびキャリア密度の評 価

半導体において一般的な不純物ドー ピングによるキャリアの導入ではなく、 空孔などの格子欠陥の形成によりキャ リアを生成する手法をとった。このよう な格子欠陥制御により高密度にキャリ アを導入した。硫化銅(Cu₂S)の場合に は、銅欠損を導入すると価電子帯に高密 度に正孔が生成するので、銅欠損(銅空 孔)を導入した硫化銅ナノ粒子(Cu_{2-x}S ナノ粒子)を湿式法により合成した。銅 空孔の量とナノ粒子のサイズを精密に 制御した Cu_{2-x}S ナノ粒子を作製した。

具体的には、酢酸銅と硫黄をドデカン チオールと各種アルキルアミン中で加 熱還元し、出発原料中の銅と硫黄の比を 変化させた硫化銅ナノ粒子を合成した。 ナノ粒子のサイズと形状は透過電子顕 微鏡(TEM)で評価した。元素組成比は エネルギー分散型X線分光とX線光電子 分光(XPS)で評価した。キャリア密度 は吸収スペクトルを解析して見積もっ た。

(2)硫化銅ナノ粒子の近赤外吸収帯の起

源の同定

近赤外吸収帯が局在プラズモン共鳴 に由来することを確認するため、誘電率 の異なる溶媒に硫化銅ナノ粒子を分散 させて吸収スペクトルを観測した。局在 共鳴プラズモンに特有のピーク周波数 の誘電率依存性を示すことを確かめた。 依存性の程度が局在プラズモン共鳴と して妥当であることを、ナノ粒子の構造 モデルに基づいて解析して示した。

(3)硫化銅ナノ粒子への電子注入による 正孔密度制御

硫化銅ナノ粒子の自由キャリアであ る価電子帯の正孔密度を、価電子帯への 電子注入により精密制御することを目 指した。電荷移動錯体を形成することで 有名な有機硫黄化合物であるテトラチ アフルバレン(TTF)を硫化銅ナノ粒子 に吸着させて正孔密度制御を試みた。

(3)硫化銅ナノ粒子における局在プラズ モン-励起子協奏現象の研究

キャリア密度を制御した硫化銅ナノ 粒子の吸収スペクトル、発光スペクトル、 発光寿命測定をおこない、励起子と局在 プラズモンの相関により発現する光学 現象を調査した。

(4)半導体ナノ粒子と金属ナノ粒子の複 合化による励起子-局在プラズモン協奏 現象の調査

単体ナノ粒子ではなく、半導体-金属 複合ナノ粒子を対象として、半導体ナノ 粒子の励起子と金属ナノ粒子の局在プ ラズモンの協奏現象を調べた。銀ナノ粒 子を半導体層でキャップしたコアシェ ルナノ粒子の合成法を開発して試料と した。吸収スペクトル測定と、FDTD 法 (時間領域差分法)による電磁場解析を おこなった。

(5)硫化銅ナノ粒子における局在プラズ モン誘起増強光電場の評価

プラズモニクスの中核となる現象で ある局在プラズモン共鳴励起に伴って 発生する近接増強電場の評価を、非線形 分光法によりおこなった。

4.研究成果

(1)硫化銅ナノ粒子の近赤外吸収帯 本研究では、平均粒径5 nmの球形硫化 銅ナノ粒子と、直径17 nm厚さ4 nmのコ イン型硫化銅ナノ粒子を得ることに成功 した。すなわち、形状制御が可能となった。 球形ナノ粒子の吸収スペクトルの一例 を図1に示す。1.0 eV 付近にピークを持 つブロードな吸収バンドが観測された。こ のバンドの起源が局在プラズモン共鳴で あることは、ナノ粒子を分散させる溶媒の 誘電率へのピークエネルギー依存性によ り確認された。図2に各溶媒の誘電率とピ ークエネルギーの関係を示す。溶媒の誘電 率が増加するとともにピークエネルギー はわずかに低エネルギーシフトを示した。 このようなシフトは局在プラズモンバン ドの特徴と定性的に一致する。

図2の点線はミー理論により予測され る局在プラズモンバンドの誘電率依存性 である。観測された依存性はこれよりもは るかに小さい。同様の結果は多数の研究グ ループが報告しており、局在プラズモンバ ンドとしては小さい依存性の原因がわか っていなかった。

実線は、ナノ粒子の表面配位子を構造モ デルに取り入れて計算される依存性を示 している。実験結果とよく一致する依存性 が得られた。このデータは、近赤外吸収バ ンドの起源が局在プラズモン共鳴である ことを示しており、従来の解釈が間違って いないことを示す初めての結果である。表 面配位子の存在が溶媒の誘電率への依存 性を低下させていることが明らかになっ た。



図1 硫化銅ナノ粒子の吸収スペクトル





(2)銅欠損の調整による硫化銅ナノ粒子の正孔密度制御

種々のアミン種の使用と銅:硫黄比で合 成した平均粒径5 nm の球形硫化銅ナノ粒 子の吸収スペクトルを図3に示す。局在プ ラズモンバンドのピークエネルギーが異 なることがわかる。粒径には差がほぼない ので、ピークエネルギーが異なるのは自由 キャリアである正孔の密度が異なるため と考えられる。正孔密度の違いは銅欠損の 量に差があることを示唆している。しかし、 EDX と XPS により測定したこれらのナノ粒 子の銅:硫黄比は Cu₂S の構成比に対して 銅が20~40%少なかったが、局在プラズモ ンのピークエネルギーとの間に系統性は みられなかった。これはナノ粒子の凝集を 防ぐために使用した表面配位子であるド デカンチオールが持つ硫黄とナノ粒子を 構成する硫黄が区別できないためと考え られる。したがって本研究ではナノ粒子自 身の銅:硫黄比を評価することができなか った。



図3 各試料の局在プラズモンバンド

ナノ粒子サイズに差がないならば、キャ リア密度が高い方が高エネルギーに局在 プラズモンの共鳴ピークを示す。一方、約 2 eV より立ち上がるバンド間吸収にも試 料により立ち上がりのエネルギーに差が みられる。局在プラズモンバンドのピーク が高エネルギーにあるナノ粒子ほどバン ド間吸収が開始するエネルギーが高エネ ルギーにある。これは縮退半導体に特有の バースタイン・モスシフトと考えられ、バ ンド間吸収が高エネルギーにあるナノ粒 子のキャリア密度が高いことを示唆して いる。この結果からも、正孔密度の異なる 硫化銅ナノ粒子の合成ができたことが明 らかである。

局在プラズモンバンドのピークエネル ギーをバンド幅の値からミー理論により キャリア密度を見積った。その結果、ここ に示したナノ粒子のキャリア密度は 0.95 ×10²¹ cm⁻³~1.23×10²¹ cm⁻³の範囲にある ことがわかった。

(3)TTF からの電荷移動による硫化銅ナノ 粒子の正孔密度制御

コイン型硫化銅ナノ粒子をトルエンに 分散させ、これにTTFを加えて価電子帯へ の電子注入による正孔密度の低下を試み た。TTFを添加して1時間後に吸収スペク トルを測定すると、添加前と比較して約 0.1 eV だけ高エネルギー側に局在プラズ モンバンドがシフトしていた。その後、局 在プラズモンバンドは徐々に低エネルギ ーヘシフトした。この様子を図4に示す。 一方、TTFの添加量を1/10に減らして同 じ実験をおこなったところ、いったん高エ ネルギーにシフトした局在プラズモンバ ンドは10日経過しても位置が変わらなか った。この結果は、硫化銅ナノ粒子のキャ リア密度が徐々に減少したこと、TTF 濃度 が低いとこのような現象は生じないこと を示唆している。



図4 TTF 添加に伴う吸収スペクトル

の変化

局在プラズモンバンドを解析して求め たキャリア密度は、2.9×10²¹ cm⁻³から 10 日間で 2.1 × 10²¹ cm⁻³まで減少したと見積 もられた。この原因は、TTF から硫化銅ナ ノ粒子へ電子移動であり、電子が価電子帯 トップの正孔を埋めて正孔密度を低下さ せたためであると考えられる。正孔の減少 はナノ粒子一個当たり 400 個と見積もら れた。添加した TTF は、ナノ粒子1個あた り 10⁵分子で、TTF は最大 1900 分子がナノ 粒子の表面に吸着できると予想される。し たがって TTF 分子を最大限に吸着させる ことができれば、硫化銅ナノ粒子の正孔密 度を大幅に減少させられると期待でき、局 在プラズモン共鳴の新しい制御法として 注目される。

(4)硫化銅ナノ粒子の局在プラズモン-励 起子相互作用

本研究で得られた正孔密度を制御した 硫化銅ナノ粒子は、最も正孔密度が高いナ ノ粒子についてもバンド間遷移と局在プ ラズモンバンドがエネルギー的に離れて いる。局在プラズモンと励起子の相互作用 は両者が同じエネルギーを持たないと働 かないと考えられる。これを実現するには、 さらに高い正孔密度が必要であり、それに は銅欠損の数を増加させる必要がある。し かし、本研究のナノ粒子合成法では、研究 期間内にこれを実現することはできなか った。格子欠陥の導入とは異なるアプロー チが必要と考えられる。

(6)半導体-金属複合ナノ粒子の局在プラズモン-励起子相互作用

直径 5 nm の銀ナノ粒子を厚さ 2 nm

の半導体 CuInS₂層でキャップしたコア シェルナノ粒子の合成に成功した。図5 に複合ナノ粒子の吸収スペクトルを示 す。図には銀ナノ粒子単体とCuInS₂ナノ 粒子単体の吸収スペクトルも示した。銀 ナノ粒子には局在プラズモンバンドが 観測されたが、複合ナノ粒子にはこれと は異なるエネルギーにブロードな吸収 バンドが観測された。図6にはFDTD 法 により計算した複合ナノ粒子の吸収ス ペクトルを示す。吸収スペクトルは定性 的に実験結果を再現している。



図5 複合ナノ粒子の吸収スペクトルと 銀ナノ粒子、CuInS₂ ナノ粒子の吸収ス ペクトル



図6 複合ナノ粒子の吸収スペクトル

(実験とFDTD計算)

計算により得られた吸収ピークエネ ルギーにおける光電場分布を FDTD 法に より求めたところ、半導体と金属の界面 に強く電場が局在することがわかった。 これは銀の局在プラズモンと CuInS₂の 励起子の間に何らかのカップリングが 生じることを示唆している。すなわち本 研究で念頭にあった励起子光学応答と 局在プラズモン共鳴の協奏が、少なくと もそれぞれ別のナノ構造体に存在する 場合には、観測されることがわかった。

(7)局在プラズモン誘起増強光電場

平均粒径 4.5 nm の球形硫化銅ナノ粒子 の三次非線形感受率 ($\chi^{(3)}$)を測定した。 $\chi^{(3)}$ は局在プラズモンピーク付近で共鳴増 大することが知られている。これは局在プ

ラズモン励起に伴いナノ粒子に巨大な分 極が生成するためである。この分極によっ てナノ粒子近傍には強い近接場が発生す る。したがってχ⁽³⁾の値は近接場の指標に なり得る。図7に局在プラズモン共鳴近傍 で測定したχ⁽³⁾を示す。同時に同じサイズ の金ナノ粒子のχ⁽³⁾も示してある。χ⁽³⁾はナ ノ粒子濃度の補正をおこなった値である。 この結果、硫化銅ナノ粒子のχ⁽³⁾は金ナノ 粒子と同程度であることが明らかになっ た。共鳴周波数と溶媒の屈折率の違いを含 めて解析した結果、硫化銅ナノ粒子の近接 場は金ナノ粒子の半分程度と見積もられ た。この結果は半導体ナノ粒子の局在プラ ズモンにおけるχ⁽³⁾の報告としては初めて のものであり、新たな近接場の評価法とし て注目された。



図7 硫化銅ナノ粒子と金ナノ粒子の 三次非線形感受率

5.主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計7件)

"Synthesis of highly non-stoichiometric Cu₂ZnSnS₄ nanoparticles with tunable bandgaps", <u>Y. Hamanaka</u>, W. Oyaizu, M. Kawase, and <u>T. Kuzuya</u>, Journal of Nanoparticle Research 19, 9 (2017). 査読 有 DOI:10.1007/s1105-016-3704-7

"Synthesis of Ag/CuInS₂ core-shell nanoparticles", <u>T. Kuzuya</u>, T. Kuwada, <u>Y.</u> <u>Hamanaka</u>, and S. Hirai, Materials Transactions 58, pp.65-70 (2017). 査読有 DOI:10.2320/matertrans.M2016026

"Plasmonic enhancement of third-order nonlinear optical susceptibilities in self-doped Cu_{2-x}S nanoparticles", <u>Y.</u> <u>Hamanaka</u>, T. Hirose, K. Yamada, and <u>T.</u> <u>Kuzuya</u>, Optical Materials Express 6, pp.3838-3848 (2016). 査読有 DOI: 10.1364/OME.6.003838 「硫化銅ナノ粒子の近赤外局在表面プ ラズモンの三次光学非線形性」、<u>濱中</u> 泰、分子科学研究所機器センターたよ り、No.8、pp.87-90、(2016). 査読無

「カルコゲナイド系材料を用いた環境 調和型半導体ナノ粒子の創製と光機能 性の研究」、<u>濱中</u>泰、新東技報、第3 4号、新東工業株式会社、pp.87-88、 (2016). 査読無

"Structural transformation and photoluminescence modification of AgInS₂ nanoparticles induced by ZnS shell formation", <u>Y. Hamanaka</u>, D. Yukitoki, and <u>T. Kuzuya</u>, Applied Physics Express 8, pp.095001-1 - 095001-4 (2015). 查読有

DOI:10.7567/APEX.8.095001

"Enhancement of donor-acceptor pair emissions in colloidal AgInS₂ quantum dots with high concentrations of defects", <u>Y. Hamanaka</u>, K. Ozawa, and <u>T. Kuzuya</u>, Journal of Physical Chemistry C118, pp.14562-14568 (2014). 查読有 DOI:10.1021/jp501429f

[学会発表](計9件) 桑田貴彦、<u>濱中 泰、葛谷俊博、「カ</u> チオン交換法による Ag/CuInS₂ 複合ナ ノ粒子の合成」第77回応用物理学会 秋季学術講演会、平成28年9月15日、 朱鷺メッセ(新潟県・新潟市)

> 山田 薫、廣瀬達徳、<u>濱中 泰、葛谷</u> <u>俊博</u>、「Cu_{2-x}Sナノ粒子の局在表面プ ラズモン光学特性 V」、日本物理学会 2016 年秋季大会、平成 28 年 9 月 15 日、金沢大学(石川県・金沢市)

> 廣瀬達徳、山田 薫、<u>濱中 泰、葛谷</u> <u>俊博</u>、「硫化銅ナノ粒子の近赤外局在 表面プラズモン特性」、ナノ学会第14 回大会、平成28年6月14日、北九州 国際会議場(福岡県・北九州市)

> 山田 薫、廣瀬達徳、<u>濱中 泰、葛谷</u> <u>俊博</u>、「Cu_{2-x}Sナノ粒子の局在表面プ ラズモン光学特性 IV」、日本物理学会 第71回年次大会、平成28年3月21 日、東北学院大学泉キャンパス(宮城 県・仙台市)

桑田貴彦、<u>濱中 泰、葛谷俊博</u>、「プ ラズモン特性を示す Ag-CulnS₂複合ナ ノ粒子の合成」、第76回応用物理学会 秋季学術講演会、平成27年9月15日、 名古屋国際会議場(愛知県・名古屋市) 山田 薫、廣瀬達徳、<u>濱中 泰、葛谷</u> <u>俊博</u>、「Cu_{2-x}Sナノ粒子の局在表面プ ラズモン光学特性 III」、日本物理学会 2015 年秋季大会、平成 27 年 9 月 18 日、関西大学千里山キャンパス(大阪 府・吹田市)

桑田貴彦、<u>濱中</u>泰、<u>葛谷俊博</u>、「液 相法による Ag-CuInS₂ 複合ナノ粒子の 合成 _トナノ学会第 13 回大会、平成 27 年 5 月 13 日、東北大学片平さくら ホール(宮城県・仙台市)

廣瀬達徳、山田 薫、<u>濱中 泰、葛谷</u> <u>俊博</u>、「Cu_xS ナノ粒子の局在表面プラ ズモン光学特性 II」、日本物理学会第 70回年次大会、平成 27 年 3 月 23 日、 早稲田大学早稲田キャンパス(東京 都)

廣瀬達徳、山田 薫、<u>濱中 泰、葛谷</u> <u>俊博</u>、「Cu_xS ナノ粒子の局在表面プラ ズモン光学特性」、日本物理学会 2014 年秋季大会、平成 26 年 9 月 10 日、中 部大学春日井キャンパス(愛知県・春 日井市)

〔図書〕(計0件)

〔産業財産権〕

出願状況(計0件)

取得状況(計0件)

〔その他〕 なし

6.研究組織

 (1)研究代表者 濱中泰 (HAMANAKA, Yasushi)
名古屋工業大学・大学院工学研究科・准教授
研究者番号:20280703

(2)研究分担者 なし

(3)連携研究者
葛谷 俊博 (KUZUYA, Toshihiro)
室蘭工業大学・工学部・助教
研究者番号:00424945

(4)研究協力者 なし